

第34回表面分析研究会プログラム

「オージェ電子分光の実力と将来像」

開催日時: 2010年 3月 4日(木) 13:40 ~ 5日(金) 16:00

開催場所: キャンパスプラザ京都

第1日目: 3月4日(木) テーマセッション

13:00 ~ 13:30	参加登録受付	
13:30 ~ 13:40	開会挨拶	
テーマセッション基調講演		
13:40 ~ 14:30	オージェ電子分光の果たしてきた役割と今後の展望	吉原 一紘(オミクロンテクノロジー・ジャパン(株))
テーマセッション通常講演		
14:30 ~ 15:00	オージェ電子分光法による化学状態分析	堤 建一(日本電子(株))
15:00 ~ 15:30	CMAオージェの特徴と有用性	眞田 則明, 鈴木 峰晴(アルバック・ファイ(株))
15:30 ~ 15:50	休憩(20分)	
15:50 ~ 16:20	【PSA-09 Powell賞受賞記念講演】 半球型電子分光器を搭載したオージェ電子分光装置のジオメトリー特性と傾斜ホルダーを利用した超高深さ分解能オージェ深さ方向分析	荻原 俊弥((独)物質・材料研究機構)
16:20 ~ 16:45	オージェ電子分光法での帯電対策	薮 久美((株)日立製作所 中央研究所)
16:45 ~ 17:10	高真空下のオージェ測定	小西 郁夫((株)島津製作所)
フリートークセッション (皆さんの自由な討議の場として御利用いただく時間です)		
17:10 ~ 17:30	フリー	フリー
懇親会		
18:30 ~ 20:30	懇親会	

第2日目: 3月5日(金)

9:15 ~ 9:30	参加登録受付	
プロジェクト/WG 報告		
9:30 ~ 10:00	電子線損傷プロジェクト報告	木村 隆((独)物質・材料研究機構)
10:00 ~ 10:20	ToF-SIMS WG 報告	阿部 芳巳(三菱化学(株))
10:20 ~ 10:40	XPS WG 報告	當麻 肇((株)日産アーク)
10:40 ~ 11:00	休憩(20分)	
11:00 ~ 11:20	Background プロジェクト報告	田沼 繁夫((独)物質・材料研究機構)
11:20 ~ 11:40	ノイズ評価プロジェクト報告	福島 整((独)物質・材料研究機構)
11:40 ~ 13:20	昼食・休憩(100分)	
話題提供		
13:20 ~ 13:45	究極のクラスタ分類器の紹介 -AESスペクトルデータ等への応用-	徳高 平蔵((有)SOMジャパン)
13:45 ~ 14:10	反射電子エネルギー損失スペクトルにおける因子分析の基礎的扱い	吉川 英樹((独)物質・材料研究機構)
14:10 ~ 14:35	多変量解析のTOF-SIMSイメージへの応用	河野 禎市郎(旭化成(株))
14:35 ~ 14:55	休憩(20分)	
14:55 ~ 15:20	オージェ電子分光装置を用いたハードディスク読み書き用ヘッド表面のDLC膜厚測定法	松村 純宏 ((株)日立グローバルストレージテクノロジーズ)
15:20 ~ 15:45	XPSによる酸化銀のケミカルシフト	藺林 豊(京都大学)
連絡・挨拶		
15:45 ~ 16:00	連絡、閉会挨拶	